

Title (en)
Olefinically unsaturated onium salts.

Title (de)
Olefinisch ungesättigte Oniumsalze.

Title (fr)
Sels d'onium à insaturation oléfinique.

Publication
EP 0473547 A1 19920304 (DE)

Application
EP 91810657 A 19910820

Priority
CH 276590 A 19900827

Abstract (en)
Olefinically unsaturated onium salts of the formulae I and II <IMAGE> in which R1 is a hydrogen atom or methyl and A is a direct bond, phenylene or one of the following radicals <IMAGE> in which n and o independently of one another each represents a number from 1 to 10, Y1 represents I or S-R2 and Y2 represents S-R2, where R2 is a C1-C4-alkyl, unsubstituted or C1-C4-alkyl-substituted phenyl, m is zero or a number from 1 to 10 and X is BF4, PF6, AsF6, SbF6, SbCl6, FeCl4, SnF6, BiF6, CF3SO3 or SbF5OH, can be copolymerised with an olefinically unsaturated comonomer which contains an acid-labile group and give copolymers which are sensitive to radiation and can be used directly as photoresists.

Abstract (de)
Olefinisch ungesättigte Oniumsalze der Formeln I und II <IMAGE> <IMAGE> worin R1 ein Wasserstoffatom oder Methyl und A eine direkte Bindung, Phenylen oder einen der folgenden Reste <IMAGE> bedeuten, wobei n und o unabhängig voneinander je für eine Zahl von 1 bis 10 stehen, Y1 für J oder S-R2 und Y2 für S-R2 stehen, wobei R2 ein C1-C4-Alkyl, unsubstituiertes oder C1-C4-alkylsubstituiertes Phenyl bedeutet, m für Null oder eine Zahl von 1 bis 10 und X für BF4, PF6, AsF6, SbF6, SbCl6, FeCl4, SnF6, BiF6, CF3SO3 oder SbF5OH stehen, lassen sich mit einem olefinisch ungesättigten, eine säurelabile Gruppe enthaltenden Comonomer copolymerisieren und ergeben strahlungsempfindliche Copolymere, die direkt als Photoresists eingesetzt werden können.

IPC 1-7
C07C 381/12; G03F 7/027

IPC 8 full level
B41N 1/08 (2006.01); **C07C 69/65** (2006.01); **C07C 309/06** (2006.01); **C07C 381/12** (2006.01); **C07F 7/08** (2006.01); **C08F 12/00** (2006.01); **C08F 12/32** (2006.01); **C08F 16/14** (2006.01); **C08F 216/12** (2006.01); **C08F 220/26** (2006.01); **C08F 220/30** (2006.01); **G03C 1/50** (2006.01); **G03F 7/039** (2006.01)

CPC (source: EP KR)
C07C 323/50 (2013.01 - KR); **C07C 381/12** (2013.01 - EP); **G03F 7/039** (2013.01 - EP)

Citation (search report)
• [AD] DE 3902114 A1 19900802 - BASF AG [DE]
• [AP] EP 0406567 A2 19910109 - MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO [JP]
• [A] US 3494965 A 19700210 - JONES GIFFIN D, et al
• [A] EP 0379464 A1 19900725 - CIBA GEIGY AG [CH]
• [A] US 4069054 A 19780117 - SMITH GEORGE H

Cited by
KR100852540B1; EP2577397A4; US7049044B2; EP0773478A1; US5928840A; US10054853B2; US9086625B2; US8048610B2; WO0244815A3; WO0244814A3; WO0025178A3; WO2006017014A3; US8841061B2; US9146464B2; US8114570B2; US9310683B2; US8211618B2; US10234757B2; US7235344B2; US8632939B2; US9017918B2; US9091918B2; US8735046B2; US9052602B2; US7670751B2; US8911929B2; US9164392B2; US8450042B2; US8574817B2; US8828641B2; US8623590B2; US8686166B2; US8778592B2; US9057959B2; US7923195B2; US8859181B2; US9040223B2; US9152050B2; US7569324B2; US8057985B2; US8685616B2; US8808966B2; US9201300B2; US10310375B2; EP1914596A2; US7776505B2; US8114571B2; US8394570B2; US9829792B2; US6884562B1; US7261993B2; US8039198B2; US8119392B2; US8815492B2; US9760003B2; US7887991B2; US7919226B2; US8609889B2; US9075308B2; US9250523B2; US9360753B2; US7511169B2

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0473547 A1 19920304; CA 2049772 A1 19920228; JP H04230645 A 19920819; KR 920004343 A 19920327

DOCDB simple family (application)
EP 91810657 A 19910820; CA 2049772 A 19910823; JP 24062591 A 19910827; KR 910014765 A 19910826